

MLL-C500/C900无掩模直写光刻设备

——精巧型直写光刻设备



HIGH PERFORMANCE,
MASKLESS LITHOGRAPHY TOOLS

MLL-C500/C900无掩模直写光刻设备

——精巧型直写光刻设备

HIGH PERFORMANCE,
MASKLESS LITHOGRAPHY TOOLS

MLL-C500/C900无掩模直写光刻设备是由合肥芯基微电子装备有限公司自主研发生产的一款精巧型光刻设备，其功能灵活、体积小、性价比高，专为世界各大高校及研究所量身打造。

主要功能及特征

器件无掩模直写光刻功能

光掩模版制作功能

3D结构曝光功能

自动对准功能

背部对准功能

用户自定义标记对准功能

可视化定点曝光功能

自动聚焦功能

快速、精细两种曝光方式

405nm (375nm可选) LED光源

多种数据输入格式 (DXF/CIF/GDSII/Gerber*选配/BMP/TIFF)

基于Windows系统，用户界面简单，易于操作使用

不规则样品曝光

小批量，多品种



应用领域

MEMS

掩模版制作

IC器件

生物芯片

3D光刻

微传感器

微流体控件

关键技术指标

精巧型光刻设备		MLL-C900		MLL-C500	
Item	Unit	I	II	I	II
支持最大基板尺寸	[inch]	8 inch (可拓展)		6 inch (可拓展)	
最大曝光面积	[mm ²]	200X200		150X150	
最小解析	[μm]	0.6	2	0.9	2
数据网格精度	[nm]	70	140	80	160
线宽均匀性	[nm]	150	300	200	400
套刻对准精度	[nm]	500		800	
产能	[mm ² /min]	60	120	15	60